



講演情報

一般セッション(口頭講演)

12 有機分子・バイオエレクトロニクス 12.4 有機EL・トランジスタ

[13p-A409-1~14] 12.4 有機EL・トランジスタ

2020年3月13日(金) 13:15 ~ 17:30 A409 (6-409)

野田 啓(慶大)、横田 知之(東大)、丸本 一弘(筑波大)

△：奨励賞エントリー

▲：英語発表

▼：奨励賞エントリーかつ英語発表

空欄：どちらもなし

16:15 ~ 16:30

[13p-A409-11] 高純度オゾンとTMAを用いた室温ALD法により成膜した Al_2O_3 膜の水蒸気透過率

○阿部 綾香¹、萩原 崇之¹、亀田 直人¹、三浦 敏徳¹、森川 良樹¹、花倉 満¹、中村 健²、野中 秀彦² (1.(株)明電舎、2.産総研)

キーワード：バリア性、室温ALD、高純度オゾン

明電舎製ピュアオゾンジェネレーターから~100%- O_3 を供給し、 O_3 のみを酸化源とした室温ALD法 (Pure-Ozone-ALD:PO-ALD)をTMAに適用し、PENフィルム上に Al_2O_3 膜の成膜を試みた。

当日はそのフィルムの水蒸気透過率(WVTR)や膜質について議論する。